

Our History

社会の期待に、化学で応え続ける

4つの経営理念「自由闊達」「技術のたゆまざる研鑽」「製品の高度化」「社会への貢献」のもと、あらゆる経営資源や取組みを「社会への貢献」に帰結させてきた東京応化は、これからも、社会の期待に化学で応え続けることで、人々の豊かな生活や、社会の持続的発展に貢献していきます。

2010th～現在 Innovation Driven



台湾東應化社



韓国・TOK先端材料社



ターゲット市場：5G&IoT、AI

2020年
過去最高業績達成



EUV用フォトレジスト

2000th Opportunity Expansion



ArF用フォトレジスト



Zero Newton®用
ボンダー（貼付）装置



最終製品例：スマートフォン

1990th Global No. 1



郡山工場



K1F用フォトレジスト

最終製品例：携帯電話

グローバルニッチトップ企業へ

成長軌道に回帰した当社は、1994年の郡山工場の開設により増産体制を強化。1997年に開発した K1F用フォトレジストは世界標準品として多くの半導体メーカーに採用されました。以降も国内外の開発・生産体制を強化し、フォトレジストというニッチな高付加価値分野で、世界トップメーカーとしての地位を固めていきました。

1980th Resilience



初の海外拠点となったOHKA AMERICA, INC.
(現TOKアメリカ社)



i線用フォトレジスト

最終製品例：PC

経営基盤を強化し、 再成長への布石を打つ

g線用フォトレジストのシェア拡大や装置事業の展開により成長を遂げた東京応化は、1985年からの半導体不況の洗礼を受けながらも、1986年の株式上場や1987年のi線用フォトレジストの上市、初の海外拠点としてのOHKA AMERICA, INC. の開設等を果敢に進め、1990年代からの再成長につなげました。

1970th Pioneering



環境対応型
合成ゴム系レジスト

国産初の半導体用
ポジ型フォトレジスト



最終製品例：電卓*2

“フォトレジストの東京応化”の 確立と環境対応

1968年にフォトレジスト事業を本格化させた当社は、高純度化技術と微細加工技術を活かし、1971年に環境対応型合成ゴム系レジスト、1972年に国産初の半導体用ポジ型フォトレジストを開発。半導体製造に欠かせない“フォトレジストの東京応化”として、電卓の高性能化、ワープロやPCの登場に貢献するなど、ビジネスの効率化を支えました。

1940 Origin



創業者 向井繁正



昭和初期の炭坑用キャップライトと蓄電池
(イメージ)

創業以来のDNA

「どのような困難があったとしても、社会に役立つ、他社が手掛けないような製品の開発に挑戦したい」という強い理想を掲げた創業者・向井繁正は、1934年、炭坑用キャップライト向け蓄電池材料を足掛け6年の苦勞の末に開発。昭和初期の石炭産業の安全確保に貢献しました。



世界の半導体市場
1986年
26,355百万米ドル

世界の半導体市場
2020年
440,389百万米ドル

*1 1987年までは11月期決算、1988年～2017年は3月期決算、2018年以降は12月期決算(決算期変更による変則決算は除く)
*2 当ページの最終製品例の写真は、いずれもイメージです。
*3 該当年代については、当社推定を含みます。